



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest developer

- Wywoływacz (developer) „gotowy do użycia” - 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 5l

2 Parametry

5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
1. Wywoływacz (developer)	Właściwości materiału	• Wywoływacz umożliwiający uzyskanie stromych ścian • Roztwór 2.38 % TMAH • Zawiera środki powierzchniowo czynne w celu szybkiego i jednorodnego zwilżania podłoża • Zawiera dodatki do usuwania resztek maski pozostałych po wywołaniu • Zawiera składnik, który zaatakuje lekko usieciowaną maskę, podczas gdy mocniej usieciowana maska pozostanie nietknięta • Kompatybilny z fotorezystem negatywowym
	Forma materiału	• Wywoływacz dostarczany w formie jednoskładnikowej
	Pakowanie materiału	• Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wytrawiacz chromowy (Chromium Etchant):

- Wytrawiacz chromowy – 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 5l

2 Parametry

5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
1. Wytrawiacz chromowy (Chromium Etchant)	Właściwości materiału	• Alkaliczny wytrawiacz do Chromu • Umożliwia usuwanie cienkich warstw Chromu z selektywnością do metali: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta • Stosowany przy produkcji półprzewodników • Kompatybilność z materiałami: Si, SiO₂, Si₃N₄ • Nie reaguje z: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta • Może być wykorzystany do wytrawienia warstwy maski/bariery Chromu • Możliwość zwiększenia szybkości trawienia przez podwyższoną temperaturę do 40°C • Niskie podcięcia warstw (w zakresie grubości warstwy), minimalna wielkość cechy <1 µm • Selektywność do wielu materiałów m.in. metale nieszlachetne • Szybkość trawienia: około 10 – 15nm/min w temperaturze 40°C i odpowiednio niższa w temperaturze pokojowej • Warstwa 30nm Chromu trawi się w około 180 sekund • Wytrawiacz stabilny w czasie i może być wykorzystywany wielokrotnie przy danej aplikacji
	Forma materiału	• Wytrawiacz dostarczany w formie jednoskładnikowej gotowej do użycia
	Pakowanie materiału	• Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymywacz

- Wymywacz (remover) „gotowy do użycia” - 2 sztuki, umieszczone w pojemnikach 5l

2 Parametry

5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
1. Wymywacz (remover)	Właściwości materiału	• Wymywacz do fotorezystów negatywowych • Wysoka wydajność rozpuszczania • Kompatybilność z głównymi materiałami podłoży • Szybkość wymywania: $>10\mu\text{m}/\text{min}$ • Żywotność kąpieli do 72h w 65°C • Całkowita mieszalność z wodą • Nie zawiera hydroksyloaminy
	Forma materiału	• Wymywacz dostarczany w formie jednoskładnikowej
	Pakowanie materiału	• Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozpuszczalnik (solvent):

- Rozpuszczalnik do wałków z fotorezystu – 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 5l

2 Parametry

5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
1. Rozpuszczalnik fotorezystu	Właściwości materiału	• Charakteryzuje się niską prężnością par i tłumienia tworzenia się cząstek • Możliwość stosowania do usuwania krawędzi • Gęstość: 0.97 g/cm³ • Temperatura topnienia: -66°C • Temperatura wrzenia: 125°C • Temperatura zapłonu: 45°C • Ciśnienie pary w 20°C: 5 hPa
	Forma materiału	• Rozpuszczalnik dostarczany w formie jednoskładnikowej
	Pakowanie materiału	• Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są fotorezysty negatywowe jako pozycje:

- Fotorezyst negatywowo o lepkości 115 CPS – 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 0.25l
- Fotorezyst negatywowo rozcieńczony w stopniu 1:0.50 – 2 μm , umieszczony w pojemniku 0.25l

2 Parametry

5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
1. Fotorezyst negatywowo	Właściwości materiału	• Fotorezyst negatywowo • Lepkość materiału: 115CPS • Grubość filmu przy jednorazowej aplikacji: 6 μm • Wygrzewanie: 110°C/120sec. • Światłoczułość: Dawka = 300 $\pm$ 50 mJ/cm²; Focus: 1 $\pm$ 0,5 μm • PEB: 120°C/60sec. • Pozwala uzyskać boczne strome ściany, które zwężają się od dołu do góry • Doskonała przyczepność, brak potrzeby stosowania podkładu • Szeroka kompatybilność podłoża: Cu, Au, Ti, NiFe
	Forma materiału	• Fotorezyst dostarczany w formie jednoskładnikowej
	Pakowanie materiału	• Materiał dostarczany w jednej butelce o pojemności 0.25 l
2. Fotorezyst negatywowo rozcieńczony	Właściwości materiału	• Fotorezyst negatywowo • Fotorezyst z pierwszego punktu powyżej, rozcieńczony w stopniu 1: 0.50 – 2 μm
	Forma materiału	• Fotorezyst dostarczany w formie jednoskładnikowej
	Pakowanie materiału	• Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 0.25 l